

立即发布

投资者关系:

Ed Lockwood
投资者关系高级总监
(408) 875-9529
ed.lockwood@kla-tencor.com

媒体关系:

Meggan Powers
企业宣传高级总监
(408) 875-8733
meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 推出新型缺陷发现与监控技术

NanoPoint™ 利用关键图案实现

快速实用的设计检验和高度灵敏的工艺监控

【加州 MILPITAS 2013 年 4 月 23 日讯】今天，[KLA-Tencor 公司](#)（纳斯达克股票代码：KLAC）宣布为其 2900 系列缺陷检测系统推出一套新的专利技术——NanoPoint™。NanoPoint 能够在现有光学缺陷检测设备上，采用一种全新方法以光学速度进行发现和监控缺陷。NanoPoint 的价值已经体现在初期金属层上，例如在先进工艺节点的生产线上，密集图案上的线边缘粗糙度 (LER) 以前曾经制约了对细微的致命缺陷进行检测的能力。

KLA-Tencor 公司副总裁兼晶圆检测 (WIN)部总经理 Keith Wells 表示：“我们的客户热切期望继续推进 20 纳米以下工艺节点的线上光学缺陷检测。他们想要只有光学检测才能提供的速度和基线保持, 而与此同时，我们面临的挑战则是要设计出能够发现远远小于检测波长的缺陷的设备。我们过去曾针对光源、光学元件及其他子系统提出过各种改进，但 NanoPoint 则是从一个新的角度解决问题。根据客户反馈，我相信 NanoPoint 是一项突破性技术，在多样制成和工艺模块上均具有应用潜力。”

NanoPoint 将光学检测系统的资源集中于电路设计师或已知缺陷部位所确定的关键图案。在芯片开发阶段，NanoPoint 能够在数小时内检验是否需要重新设计掩膜，从而大大加快设计问题的确认与解决速度，将用时从数月之久缩短至数日之内。在批量生产阶段，NanoPoint 能够专门追踪关键图案内的缺陷状况——令工艺监控的灵敏度和速度远远超越业界迄今为止所能达到的水准。

NanoPoint 技术拥有若干新型专利支持，是 KLA-Tencor 公司在其晶圆检测部和 KT 实验室（首席技术官 Ben Tsai 博士领导下的研究机构）内历经长期研发努力而形成的产品。北美、欧洲和亚洲的主要逻辑电路、晶圆代工及内存芯片制造商已经安装了多套 NanoPoint 系统。要了解关于 NanoPoint 技术的更多信息，请参阅 KLA-Tencor 的 [2900 系列产品网页](#)。

关于 KLA-Tencor:

KLA-Tencor 公司是工艺控制与成品率管理解决方案的领先提供商，它与全球客户合作，开发先进的检测与计量技术。这些技术为半导体、发光二极管 (LED) 及其他相关纳米电子产业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及世界一流的工程师与科学家团队，超过三十五

年以来一直致力于为客户打造优秀的解决方案。KLA-Tencor 的总部设在美国加利福尼亚州米尔皮塔斯 (Milpitas)，并在全球各地设有专业的客户运营与服务中心。如需更多信息，请访问网站 <http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P)。

前瞻性声明：

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 NanoPoint 技术或 2900 系列缺陷检测系统的预期性能、半导体产业的趋势以及与之相关的预期挑战，KLA-Tencor 的客户对 NanoPoint 技术或 2900 系列产品的预期使用，以及 NanoPoint 技术或 2900 系列产品用户可以实现的预期成本、运营及其他受益等陈述，均为前瞻性声明，并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的“安全港”(Safe Harbor) 条款的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期，且包含诸多风险与不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题抑或其他问题），其他公司推出竞争性产品，或影响 KLA-Tencor 产品的实现、性能或使用的意外技术挑战或限制，实际结果可能与此类声明中的预计结果不同。

###